

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【公表番号】特表2010-510185(P2010-510185A)

【公表日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2010-013

【出願番号】特願2009-536708(P2009-536708)

【国際特許分類】

C 07 C 303/28 (2006.01)

C 07 C 309/73 (2006.01)

C 07 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 07 C 303/28

C 07 C 309/73

C 07 B 61/00 300

【手続補正書】

【提出日】平成22年11月8日(2010.11.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ジオールのモノ-トシリ化のための触媒的方法における、2モル%～0.0005モル%の濃度での式(Ic)

【化1】



[式中、YはC₁₋₆アルキル、フェニル及びベンジルの群から選ばれる]の総称的アセタールの使用。

【請求項2】

式(Ic)の総称的アセタールの濃度が0.1モル%～0.005モル%である請求項1に記載の使用。

【請求項3】

式(Ic)の総称的アセタールが2,2-ジブチル-[1,3,2]ジオキサスタンノランである請求項2に記載の使用。

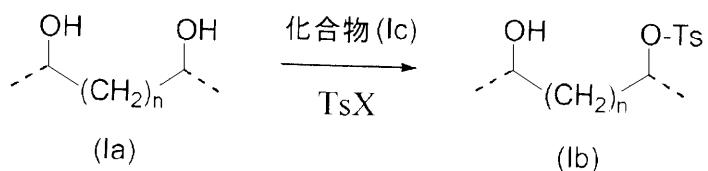
【請求項4】

ジオールが少なくとも2個そして最高で3個の炭素原子により隔てられた少なくとも2個のヒドロキシ基を含んでなる部分である請求項1～3のいずれかに記載の使用。

【請求項5】

請求項1において定義した式(Ic)の化合物を2モル%～0.0005モル%の濃度で用いて、式(Ia)のジオール部分を含んでなる化合物を式(Ib)のトシリ化ジオール部分を含んでなる化合物にトシリ化する

【化 2】



[式中、
 X は C l 、 Br 及び OTs の群から選ばれ；そして
 n は 1 又は 2 に等しい整数である]

段階を含んでなるジオーネルの触媒的モノ・トシリ化法。

【請求項 6】

式(Ic)の化合物の濃度が0.1モル%～0.005モル%である請求項5に記載の方法。

【請求項7】

式(Ic) の化合物が 2, 2-ジブチル-[1, 3, 2]ジオキサスタンノランである
請求項 6 に記載の方法。